開示の要約

基板洗浄装置、基板洗浄方法、および基板処理装置

基板を回転させ、回転する基板に洗浄部材を接触させつつ基板を洗浄する基板洗浄装置が開示される。基板洗浄装置は、前記洗浄部材を支持するアームに設けられ、前記洗浄部材に接触して洗浄部材を自己洗浄するセルフクリーニング部材と、前記洗浄部材を支持するアームに設けられ、前記セルフクリーニング部材を前記洗浄部材に接触させる位置と前記洗浄部材から離間させる位置との間で移動させる移動機構とを備える。

図１０